三组元声子晶体中的缺陷态*

李晓春† 易秀英 肖清武 梁宏宇

(中南大学物理科学与技术学院,长沙 410083)(2005年10月8日收到 2005年10月31日收到修改稿)

运用基于平面波的超元胞方法,研究作为缺陷引入的第三组元材料(四氯化碳、水)对二维二组元声子晶体(水/水银,四氯化碳/水银)带结构的影响.结果表明,二组元声子晶体在引入第三组元点缺陷/线缺陷后,在原来的带结构中会出现缺陷态/带,原带隙的位置、宽度变化不大,缺陷态/带频率主要受第三组元材料物性参数的影响,这些缺陷态都是局域化的.因此,在具有宽带隙的二组元体系中引入适当的第三组元点缺陷/线缺陷,让缺陷态/带频率落在二组元体系的带隙中,就可以形成特殊的滤声态/波导态.声子晶体的这一特性对于声波/弹性波的传播和新的声学应用具有重要意义.

关键词: 声子晶体, 三组元, 点缺陷, 线缺陷 PACC: 4320, 6320, 7155

1.引 言

近年来,经典波在周期性复合介质中传播的研究极其活跃^[1-16],并把具有弹性波禁带的周期性结构功能材料称为声子晶体^[1].类似于电子在固体中的运动,弹性波在声子晶体中传播时,也会产生所谓的'能带'结构.在声子晶体的带隙中,弹性波或声波不能传播.因此,声子晶体在隔声、隔振、军事隐身方面有着重要的应用,可用来制作声滤波器、声波导、声分离器等.同时,声子晶体的许多应用是基于缺陷的,对于缺陷态研究^[2-13],更是引起了人们广泛的注意.

目前,有关声子晶体缺陷态方面的工作已有所 报道.其中,文献9—11 研究了由圆柱或方柱水/水 银组成的点缺陷和线缺陷的情况;文献12,13 研究 了在圆柱水/水银结构中由于空腔分子的耦合特性 所形成的点缺陷,以及不同形状线缺陷的情况.而有 关于由三组元所组成的二维声子晶体的研究主要集 中在镀层方面[11—16].

本文运用基于平面波的超元胞方法,研究了作 为缺陷引入的第三组元材料(四氯化碳、水)对二维 二组元声子晶体(水/水银,四氯化碳/水银)带结构 的影响.液体/液体体系中弹性波运动方程为

$$\frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = \lambda \nabla \left(\frac{\nabla P}{\rho} \right) , \qquad (1)$$

其中 *P* 为压强,计算时,超胞大小取为 7 × 7 插入体 为方柱,按正方形排列,且填充率为 0.36,其他的物 理参数分别为水的密度 $\rho_{H_20} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,速度 $C_{H_20} = 1.48 \times 10^3 \text{ m/s}$;水银的密度 $\rho_{Hg} = 13.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,速度 m³,速度 $C_{Hg} = 1.45 \times 10^3 \text{ m/s}$;四氯化碳的密度 ρ_{ccl_4} = 1.595 × 10³ kg/m³,速度 $C_{ccl_4} = 0.938 \times 10^3 \text{ m/s}$.

二组元水/水银和四氯化碳/水银体 系的缺陷结构

图 1 给出了二维二组元声子晶体结构截面示意 图 ,插入体方柱 A 以正方形排列插入基体 B(水银) 中.A 代表水或四氯化碳方柱 ,分别构成水/水银或 四氯化碳/水银声子晶体.空腔点缺陷是通过移除中 央行插入体形成的 ;移除中央行插入体则形成空腔 线缺陷.

图 2 给出了水/水银和四氯化碳/水银两体系中 的空腔点缺陷、空腔线缺陷以及完整体系的带结构. 图 (x a) 右图表明,水/水银完整体系存在一个较大的 完全带隙,其频率范围为 0.2894 至 0.7613.其空腔

^{*}湖南省自然科学基金(批准号 104JJ3079)资助的课题.

[†] E-mail:lxc4805@yahoo.com.cn

点缺陷结构在最低完全带隙中出现了两个点缺陷 态 频率分别为 0.5198 和 0.7405,且后者是二重简 并的(见图 (a) 左图).带隙中的缺陷态可以用来滤 声 构造滤波器.水/水银空腔线缺陷结构中(图 (a) 中图),由于相邻点缺陷之间的耦合作用,点缺陷的 两个缺陷态扩展为两个缺陷带,较低的缺陷带频率 从 0.3751 变化到 0.5877,较高的缺陷带频率则从 0.6222 变化到 0.7520^[12,13],这些缺陷态都应该表现 出波导态的特征.

类似地,图 (x b)给出了四氯化碳/水银体系中空 腔点缺陷、空腔线缺陷和完整体系的带结构.完整体 系中,最低完全带隙的频率宽度从 0.2250 变化到 0.521% 图 (b)右图),对应点缺陷结构中,在最低完 全带隙中出现一个频率为 0.4731 的缺陷态(图 (b) 左图),在线缺陷结构中,出现频率范围从 0.3526 到 0.5162 的缺陷带(图 (b)中图).与水/水银体系相 比 尽管基体相同,但由于插入体不同,四氯化碳/水 银体系所得到的带隙宽度要窄,缺陷带的频率位置 也相应要低些.由此可见,声子晶体的带隙宽度和中 心频率、缺陷带的频率等与体系的物质组成关系是 十分密切的,这种密切关系在引入第三组元缺陷时 表现将更为明显.



图 1 二组元体系结构截面示意图(A 代表水或四氯化碳方柱, B 为基体水银, l 为方柱的边长, a 为晶格 常数, 方柱的填充率 $f = l^2/a^2 = 0.36$ (a) 空腔点缺陷(b) 空腔线缺陷(c) 完整结构



图 2 二组元体系带结构图(其中 ω 为频率 单位为 2πc/a,c 为声波在水银中的传播速度)(a)水/水银体 系 (b)四氯化碳/水银体系.左图 空腔点缺陷 ;中图 空腔线缺陷 ;右图 ;完整结构

图 3 是与图 2 相对应体系中部分缺陷态 *P* 点 处的压强幅度分布图 图 3(a)为水/水银体系中空腔 点缺陷态的压强幅度分布图 图中表明 在缺陷柱位 置出现了 s型点缺陷态(左图)和 p型点缺陷态(中 图和右图),它们都是局域化的 ;而水/水银体系中部 分线缺陷态的压强幅度分布则都是很好的波导态 (如图 𝔅 b)).图 𝔅 c)(d)为四氯化碳/水银体系中 空腔缺陷态的压强幅度分布图 ,空腔点缺陷在最低 带隙中仅出现 s型缺陷态(见图 𝔅 c)),线缺陷则表 现出了良好的波导态的特征(见图 𝔅 d)).



图 3 与图 2 相对应结构中缺陷带 Γ 点处的压强幅度分布图

改变填充率的大小^[11,12],缺陷态的频率会随之 发生改变,但缺陷态依然具有以上的幅度分布特征. 由此可知,缺陷态的形成主要取决于体系中材料的 组合情况,尽管基体材料一致,但当插入体材料不相 同时,所形成的缺陷带的数目、频率位置以及态的分 布都存在有一定的差异.

3. 第三组元缺陷态

图 4 给出了三组元体系截面示意图.第三组元, 即水/水银体系中的四氯化碳方柱和四氯化碳/水银 体系中的水方柱分别取代原插入体,形成第三组元 的点缺陷或线缺陷结构.第三组元插入体的形状和 单胞填充率与原插入体完全相同,排列方式也相同, 只是材料不同.对于这种结构的研究,可以明显看出 第三组元的物性参数对缺陷态的影响.



图 4 三组元体系截面示意图(■代表正常插入体(水或四氯化碳方柱)□代表第三组元(四氯化碳或水方柱),B为基体水银, l为方柱的边长,a为晶格常数,方柱的填充率 f = l²/a² = 0.36) (a)点缺陷(b)线缺陷

3.1. 四氯化碳-水/水银体系中的点缺陷和线缺陷

图 5 是四氯化碳-水/水银三组元体系中点缺陷 和线缺陷的带结构图.在点缺陷的带结构中(如图 5 (a)),所形成的带隙宽度与图 (x) a)右图中存在的完 全带隙的宽度基本是相同的,只是在带隙中存在一 个频率为 0.5703 的缺陷态,且这个缺陷态是二重简 并的,且缺陷态的频率比图 (x) a)左图中的空腔点缺 陷态频率要低,可见,这个缺陷态应该是由第三组元 四氯化碳形成的缺陷态.

在四氯化碳形成的线缺陷结构中,由于相邻点 缺陷之间的耦合作用,点缺陷态扩展为频率从 0.5433 变化到 0.6003 的线缺陷带(见图 5(b)).与图 ((a)中图中的空腔线缺陷相比,四氯化碳缺陷带的 频率宽度明显要窄.水/水银体系中的四氯化碳线缺 陷的缺陷态频率与四氯化碳/水银体系中最低带隙 的上边(见图 ((b))滞频率位置相近,但所形成态的 幅度场分布却具有完全不同的特征.四氯化碳/水银 体系中最低带隙的上边带频率态的幅度场分布是随 机的、广域的,而水/水银体系中四氯化碳线缺陷态 是局域的(后述的幅度场分布将说明这一点),这也 说明水/水银体系中第三组元四氯化碳的特征更趋 向于缺陷的特征.

图 6 是与图 5 相对应体系中部分缺陷态在 Γ 点处的压强幅度分布图.图 (a)为四氯化碳点缺陷 态的压强幅度分布图,发现都局限在四氯化碳缺陷 柱位置上,具有 p型态的特征,态的长轴方向分别在 (1,1)和(1,-1)方向,它们都是很好的局域态.图 6 (b)则为四氯化碳线缺陷态的压强幅度分布图,它们 也具有很好的局域化特征,详细分析图 (b)中所有 的缺陷态,发现它们都是沿着四氯化碳线缺陷位置



图 5 四氯化碳-水/水银体系带结构图(其中 ω 为频率,单位为 2πc/a,c为声波在水银中的传播速度)(a)四氯化碳点缺陷; (b)四氯化碳线缺陷

局域化的,因此可以用作声波导.水/水银体系中,作 为第三组元的四氯化碳线缺陷态的局域化是明显区 别于四氯化碳/水银体系中最低带隙上边带频率态 的幅度场的随机性和广域分布.这正是水/水银体系 中,第三组元四氯化碳作为缺陷的特征.

可见,三组元体系中的缺陷态/带受第三组元材 料的影响较大,改变第三组元的物性参数,缺陷态的 频率和带的宽度也会随之改变.

3.2. 水-四氯化碳/水银体系中的点缺陷和线缺陷

作为比较,我们进一步讨论了水-四氯化碳/水 银体系,其中水柱是作为第三组元引入到四氯化碳/ 水银体系中的,构造的方式和有关参数同上.



图 6 与图 5 相对应结构中的部分缺陷态 Γ 点处的压强幅度分布图

图 7 是三组元水-四氯化碳/水银体系中点缺陷 和线缺陷的带结构图.从图 7 中可以看出 最低带隙 的宽度与图 (b)中的一致 ,但第三组元水柱所形成 的缺陷态/带的频率位置都靠近原四氯化碳/水银体



图 7 三组元水-四氯化碳/水银体系中的点缺陷和线缺陷的带 结构图

系的最低带隙下边带频率,点缺陷态的频率为 0.237(如图(a)),线缺陷带的频率从0.2337 变化 到0.2613(如图(b)),这比图(b)中的空腔缺陷态 /带的频率明显要低一些.可见,第三组元材料的物 性参数对缺陷态/带的频率影响是很大的.

图 8 是与图 7 相对应结构的部分缺陷态 Г 点 处的压强幅度分布图.图 & a)对应点缺陷情况,压 强幅度分布局域在点缺陷柱位置上,具有 s型分布 特征.图 & b)对应线缺陷情况,压强幅度分布局域 在线缺陷柱位置上,可视为点缺陷态耦合而成.

因此,对于同样的三种材料,当它们的组合方式 不同时,所得到的带隙位置、宽度,缺陷态/带的频率 以及压强幅度分布情况都将存在很大的差异.完整 晶体中的空腔线缺陷可以用作波导,在完整晶体中 引入第三组元实柱线缺陷也可以实现波导结构.但 第三组元的可选择性和缺陷态频率可调性较之空腔 线缺陷更具应用上的方便性.



图 8 与图 7 相对应结构的部分缺陷态 Γ 点处压强幅度分布

4. 结 论

本文运用基于平面波的超元胞方法,研究了作 为缺陷引入的第三组元材料(四氯化碳、水)对二维 二组元声子晶体(水/水银,四氯化碳/水银)带结构 的影响.研究结果表明,无论二组元还是三组元,当 正常插入体和基体的组合相同时,无论第三组元缺 陷的材料如何,其带隙的频率宽度都是稳定的,即稳 定的二组元体系提供了一个稳定的带隙平台;在二 组元体系中引入第三组元材料后,第三组元作为缺 陷的特征是明显的,第三组元的缺陷态频率受材料 的物性参数影响较大,改变第三组元的物性参数,缺 陷态的频率和带的宽度也会随之改变;无论是空腔 缺陷结构还是第三组元实柱缺陷结构,其本征缺陷 态都是局域化的,因此,其点缺陷可用作声滤波,线 缺陷可用作声波导,对于同样的三种材料,当它们的 组合方式不同时,所得到的带隙位置、带隙宽度、缺陷态/带频率及压强幅度分布情况都将存在很大的 差异.

总之 构成声子晶体缺陷结构的方式是多样的, 影响声子晶体缺陷态的因素也是多样的.本文通过 在二组元体系中引入适当的第三组元材料形成了缺

- Kushwaha M S , Halevi P , Dobrzynski L , Djafari-Rouhani B 1993
 Phys. Rev. Lett. 71 2022
- [2] Khelif A, Djafari-Rouhani B, Vasseur J O, Deymier P A, Lambin Ph, Dobrzynski L 2002 Phys. Rev. B 65 174308
- [3] Sigalas M M 1998 J. Appl. Phys. 84 3026
- [4] Kafesaki M , Sigalas M M , García N 2000 Phys. Rev. Lett. 85 4044
- [5] Sigalas M M 1997 J. Acoust. Soc. Am. 101 1256
- [6] Kafesaki M , Sigalas M M , Garcm H N 2001 Phys. B 296 190
- [7] Khelif A, Djafari-Rouhani B, Vasseur J O, Deymier P A 2003 Phys. Rev. B 68 024302
- [8] Wu F G , Liu Y Y 2002 Acta Phys. Sin. 51 1434(in Chinese] 吴

陷结构,并讨论了第三组元材料物性对缺陷态的影响.其他如几何构型、填充率等对缺陷态的影响也是可预期的.选择不同的第三组元缺陷材料形成了对 声子晶体缺陷态的不同设计,声子晶体的这一特性 对于声波/弹性波的传播和新的声学应用具有重要 意义.

福根、刘有延 2002 物理学报 51 1434]

- [9] Wu F G , Liu Z Y , Liu Y Y 2004 Phys. Rev. E 69 066609
- [10] Wu F G , Hou Z L , Liu Z Y , Liu Y Y 2001 Phys . Lett . A 292 198
- [11] Zhang X , Liu Z Y , Liu Y Y , Wu F G. 2004 Sol . Stat . Commun . 130 67
- [12] Li X C , Liu Z Y 2005 Sol. Stat. Commun. 133 397
- [13] Li X C , Liu Z Y 2005 Phys. Lett. A 338 413
- [14] Liu Z Y , Zhang X X , Mao Y W , Zhu Y Y , Yang Z Y , Chan C T , Sheng P 2000 Science 289 1734
- [15] Zhang X , Liu Y Y , Wu F G , Liu Z Y 2003 Phys . Lett . A 317 144
- [16] Lambin Ph, Khelif A, Vasseur J O, Dobrzynski L, Djafari-Rouhani B 2001 Phys. Rev. E 63 066605

Defect states in three-component phononic crystal*

Li Xiao-Chun[†] Yi Xiu-Ying Xiao Qing-Wu Liang Hong-Yu

(School of Physics Science and Technology, Central South University, Changsha 410083, China)
 (Received 8 October 2005; revised manuscript received 31 October 2005)

Abstract

Using the supercell plane wave method, we investigated the effect of the third component material as defects modifying band structure of two-dimension two-component phononic crystal (PC). It is shown that adding the third material as point defect/linear defects in the two-component PC, defect states/bands can appear in the original band gap whose position and width would have only minor changes. The frequency of the defect states/bands are affected by the third material 's characteristics ; and all the defect states are localized. Therefore, adding proper third material as point/linear defects to the two-component system with wide band gap where defect states/bands will fall in , some special filtered/guided states will be formed. This property has important significance in acoustic /elastic wave propagating and new acoustic applications.

Keywords : phononic crystals , three-component , point defect , linear defect PACC : 4320 , 6320 , 7155

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province , China (Grant No. 04JJ3079).

[†] E-mail:lxc4805@yahoo.com.cn